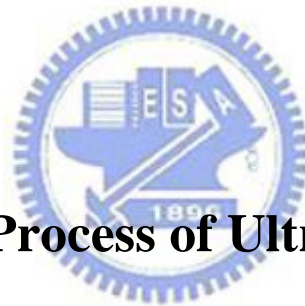


國立交通大學

電子工程學系 電子研究所碩士班

碩士論文

超薄含氮氧化層創新製程技術應用在 n 型金氧
半場效電晶體之特性研究



**New Advanced Process of Ultrathin Oxynitride
on the Characteristics of nMOSFET**

研究生：葉建宏

指導教授：葉清發 博士

羅正忠 博士

中華民國九十六年六月

超薄含氮氧化層創新製程技術應用在 n 型金氧
半場效電晶體之特性研究

**New Advanced Process of Ultrathin Oxynitride
on the Characteristics of nMOSFET**

研究生：葉建宏

Student : Chien-Hung Yeh

指導教授：葉清發 博士

Advisor : Dr. Chin-Fa Yeh

羅正忠 博士

Dr. Jen-Chung Lou

國立交通大學
電子工程學系 電子研究所碩士班
碩士論文



Submitted to Department of Electronics Engineering
& Institute of Electronics Engineering and Computer Science

National Chiao-Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science

in

Electronics Engineering

June 2007

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十六年六月